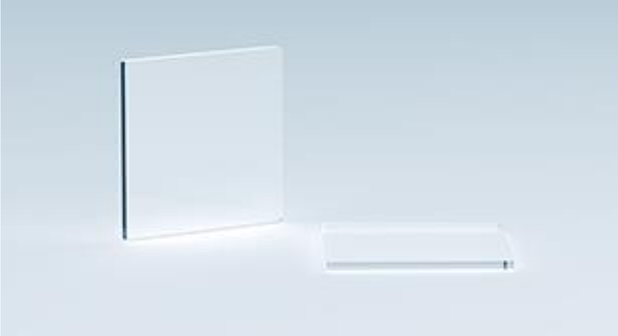
★特徴

・スペクトル透過率の高さ:

>85%@200nm、>90%@230/260nm

・主要金属不純物:Total(Σ)**< 0.5ppm**



YOFCのYSMシリーズ合成石英は、DUV領域で高い透過率を持ち、金属不純物総量0.5ppm以下の超高純度を実現したフォトマスク基板です。無バブル・無欠陥の高品質インゴットから製造され、優れた平坦度と寸法精度、低TTVにより、FPD・半導体露光工程で高い信頼性と精度を提供します。

★主な用途

・FPD（LCD／OLED）用フォトマスク基板
大判サイズ向けに最適化され、露光精度・安定性を確保。
・半導体フォトマスク/リソグラフィ用マスク
DUV領域の高透過性と低不純物により高精度パターン形成に対応。

★効果･利点

高透過率と高純度により露光精度が向上し、欠陥減少で歩留まりが改善します。低TTV・高平坦度が大型マスクでも精度を維持し、低膨張と高耐久性により長期使用でも安定した性能を発揮します。